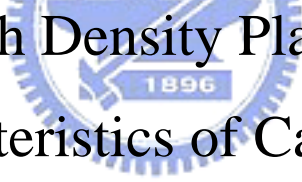


國立交通大學

電機資訊學院 電子與光電學程

碩 士 論 文

高密度電漿之後處理對奈米碳管場發射特性之
影響



Effects of High Density Plasma Post Treatments
on the Characteristics of Carbon Nanotube Field
Emission Displays

研 究 生：王文彬

Wen-Pin Wang

指 導 教 授：鄭晃忠 博士

Dr. Huang-Chung Cheng

中華民國 九十四 年 六 月

高密度電漿之後處理對奈米碳管場發射特性之影響

Effects of High Density Plasma Post Treatments on the
Characteristics of Carbon Nanotube Field Emission Displays

研究生：王文彬

Student : Wen-Pin Wang

指導教授：鄭晃忠博士

Advisor : Dr. Huang-Chung Cheng

國立交通大學
電機資訊學院電子與光電學程
碩士論文

A Thesis

Submitted to Degree Program of Electrical Engineering Computer Science

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science in

Electronics and Electro-Optical Engineering

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年六月